BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-167440

(P2002-167440A)

(43)公開日 平成14年6月11日(2002.6.11)

(51) Int.Cl.7	酸別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
C 0 8 G 79/0	2 ,	C 0 8 G 79/02	2H049
C08J 5/0	0 CEZ	C 0 8 J 5/00	CEZ 4F071
G 0 2 B 1/0	4	G 0 2 B 1/04	4 J O 3 O
3/0	0	3/00	Z
5/3	0	5/30	
	審查請求	未請求 請求項の数10	OL (全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2001-273386(P2001-273386)	(71)出顧人 00000	3159
		東レ杉	k式会社
(22)出顧日	平成13年9月10日(2001.9.10)	東京都	B中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 高西	慶次郎
(31)優先権主張番	号 特願2000-288254 (P2000-288254)	滋賀県	大津市園山1丁目1番1号 東レ株
(32)優先日	平成12年9月22日(2000.9.22)	式会社	上滋賀事業場内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 熊谷	拓也
		滋賀県	大津市関山1丁目1番1号 東レ株
		式会社	L滋賀事業場内
		(72)発明者 石鍋	亮一
		滋賀県	【大津市園山1丁目1番1号 東レ株
		式会社	上滋賀事業場内
			最終質に続く
			取終貝に続く

(54) 【発明の名称】 樹脂組成物およびその成型体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】難燃性、高屈折率、低分散特性を有する樹脂組成物を提供する。

【解決手段】樹脂組成物は、カーボネート残基、下記構造式(1)で示されるホスホン酸残基、および下記構造式(2)で示される2価フェノール残基より構成されており、ホスホン酸残基とカーボネート残基のモル分率が式(3)を満足する。

$$\begin{pmatrix} \frac{X^1}{P} \\ \frac{1}{R^1} \end{pmatrix} \tag{1}$$

[構造式(1)中、R1は有機基、X1は酸素、硫黄あるいはセレンを表し、構造式(2)中、R2は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれ、Y1は単結合、酸素原子、硫黄原

子、アルキレン基、アルキリデン基、シクロアルキレン 基、シクロアルキリデン基、ハロ置換アルキレン基等か らなる群から選ばれる。]

$$1 > (a) / {(a) + (b)} \ge 0.5$$
(3)

[式(3)中、(a)はホスホン酸残基、(b)はカーボネート残基のモル数を示す。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カーボネート残基、下記構造式(1)で示されるホスホン酸残基、および下記構造式(2)で示される2価フェノール残基より構成されており、ホスホン酸残基とカーボネート残基のモル分率が式(3)を満足することを特徴とする樹脂組成物。

【化1】

【化2】

$$1 > (a) / {(a) + (b)} \ge 0.5$$

[式(3)中、(a)はホスホン酸残基、(b)はカーボネート残基のモル数を示す。]

【請求項2】 下記構造式(4)で示されるホスホン酸 残基、および下記構造式(5)で示される2価フェノー ル残基より構成されていることを特徴とする樹脂組成 物。

【化3】

【化4】

[構造式(4)中、R3は有機基、X2は硫黄あるいは セレンを表し、樹脂組成物中にR3あるいはX2の異な るホスホン酸残基を2種以上含んでもよい。構造式

(5)中R4は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれ、p、gはp+g=0~8の整数、炭化水素基は炭素数1~20の脂肪族基、芳香族基からなる群から選ばれる。Y2は単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキリデン基、シクロアルキレン基、シクロアルキリデン基、ハロ置換アルキリデン基、ハロ置換アルキリデン基、カルボニル基、スルホン基、脂肪族ホスフィンオキシド基、芳香族ホスフィンオキシド基、アルキルシラン基、ジアルキルシラン基、フルオレン基からなる群から選ばれる。樹脂組成物中にR4あるいはY2の異なる2価フェノール残基を2種以上含んでもよい。1

【請求項3】 ホスホン酸残基の代わりに一部ホスホナ

[構造式(1)中、R1は有機基、X1は酸素、硫黄あ るいはセレンを表し、樹脂組成物中にR1あるいはX1 の異なるホスホン酸残基を2種以上含んでもよい。 構造 式(2)中、R2は各々独立に水素原子、ハロゲン原 子、炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれ、p、 qはp+q=0~8の整数、炭化水素基は炭素数1~2 Oの脂肪族基、芳香族基からなる群から選ばれる。Y1 は単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキ リデン基、シクロアルキレン基、シクロアルキリデン 基、ハロ置換アルキレン基、ハロ置換アルキリデン基、 フェニルアルキリデン基、カルボニル基、スルホン基、 脂肪族ホスフィンオキシド基、芳香族ホスフィンオキシ ド基、アルキルシラン基、ジアルキルシラン基、フルオ レン基からなる群から選ばれる。樹脂組成物中にR2あ るいはY1の異なる2価フェノール残基を2種以上含ん でもよい。

イト残基により構成され、その置換比率が50%以下である請求項1または2に記載の樹脂組成物。

(3)

【請求項4】 アッベ数が31以上である請求項1または2に記載の樹脂組成物。

【請求項5】 d線屈折率が1.60以上でかつアッベ 数が26以上である請求項1または2に記載の樹脂組成物。

【請求項6】 d線屈折率が1.62以上である請求項1または2に記載の樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1または2に記載の樹脂組成物を 含有してなる成型体。

【請求項8】 請求項7記載の成型体からなる光学レンズ。

【請求項9】 請求項1または2に記載の樹脂組成物を 含有してなるフィルム。

【請求項10】 請求項9記載のフィルムを構成材とする位相差フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学的に低分散かつ高屈折率であり、更には難燃性を有する樹脂組成物と、それを含有する成型体に関する。

[0002]

【従来の技術】無色透明材料は光学レンズ、機能性光学フィルム、ディスク基板などその多様な用途に応じて種々の材料が適用されているが、ヘルスケアやエレクトロニクスなどの急速な発展に伴い、材料自体に要求される機能・性能もますます精密かつ優れたものとなってきている。

【0003】光学用材料のヘルスケア用途として眼鏡レンズが上げられるが、薄型化、軽量化、ファッション性等の観点から活発な材料開発が行われており、現在では耐衝撃性、軽量性等の利点から、市場の90%は樹脂レ

ンズが占めるようになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の眼鏡レンズ用樹脂はCR39、アクリル、ウレタンの3つに大別され、低分散、高屈折を目指して多くの樹脂が開発実用化されている。これらの樹脂はすべて熱硬化性であるため、光学レンズへの成形は注型重合が用いられるが、この方法は重合時間が長く、その後のアニーリングプロセスなど、製造コストが高いという問題点がある。ポリカーボネートのような熱可塑性樹脂をレンズに適用すれば、成形性がよく、熱硬化性樹脂に比べ格段にレンズ製造コストを安くできるという利点があるが、屈折率が低いため(1.58)視力矯正眼鏡用途としての性能は不十分である。またポリカーボネート以上の屈折率を有する熱可塑性樹脂も数多く知られているが、高分散性、着色性等の問題があり、光学レンズ用途には適用するには問題があった。

【0005】一方、ポリカーボネートのような無色透明の熱可塑性樹脂は、エレクトロニクス用途としても広く用いられており、位相差フィルムなどの光学フィルムやディスク用基板等の用途が挙げられる。特に位相差フィルムは、反射型カラー液晶ディスプレイのコントラストを決める重要な構成部材のひとつであるが、現在用いられているポリカーボネートが例えば、特開平4-204503号公報、特開平9-304619号公報に教示されているが、これらは十分な波長分散特性を有しているとはいえない。反射型液晶ディスプレイの高コントラスト化のためには、位相差フィルムとして用いる樹脂フィルムの波長分散特性の向上がひとつの技術課題となっている。

【0006】本発明は、無色透明で高屈折、低分散など優れた光学特性を有し、また難燃性をも併せ持つ樹脂組成物、およびその成型体を提供することを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 1>(a)/{(a)+(b)}≧0.5

[式(3)中、(a)はホスホン酸残基、(b)はカーボネート残基のモル数を示す。]

また、本発明は、下記構造式(4)で示されるホスホン 酸残基、および下記構造式(5)で示される2価フェノ ール残基より構成されていることを特徴とする樹脂組成 物。

【0011】 【化7】

 $\begin{pmatrix} \frac{\chi^2}{p} \\ \frac{p}{p^3} \end{pmatrix} \tag{4}$

【0012】 【化8】 決するために以下の構成を有するものである。すなわち、カーボネート残基、下記構造式(1)で示されるホスホン酸残基、および下記構造式(2)で示される2価フェノール残基より構成されており、ホスホン酸残基とカーボネート残基のモル分率が式(3)を満足することを特徴とする樹脂組成物である。

[0008]

【化5】

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{1} \\ \frac{1}{1} \end{pmatrix}$$
 (1)

[0009]

【化6】

$$\begin{pmatrix}
(R^2)p & (R^2)q \\
0 & & 0
\end{pmatrix}$$
(2)

【0010】 [構造式(1)中、R1は有機基、X1は 酸素、硫黄あるいはセレンを表し、樹脂組成物中にR1 あるいはX1の異なるホスホン酸残基を2種以上含んで もよい。構造式(2)中、R2は各々独立に水素原子、 ハロゲン原子、炭化水素基、ニトロ基からなる群から選 ばれ、p、qはp+q=0~8の整数、炭化水素基は炭 素数1~20の脂肪族基、芳香族基からなる群から選ば れる。Y1は単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン 基、アルキリデン基、シクロアルキレン基、シクロアル キリデン基、ハロ置換アルキレン基、ハロ置換アルキリ デン基、フェニルアルキリデン基、カルボニル基、スル・ ホン基、脂肪族ホスフィンオキシド基、芳香族ホスフィ ンオキシド基、アルキルシラン基、ジアルキルシラン 基、フルオレン基からなる群から選ばれる。樹脂組成物 中にR2あるいはY1の異なる2価フェノール残基を2 種以上含んでもよい。]

【0013】 [構造式(4)中、R3は有機基、X2は 硫黄あるいはセレンを表し、樹脂組成物中にR3あるいはX2の異なるホスホン酸残基を2種以上含んでもよい。構造式(5)中R4は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ニトロ基からなる群から選ばれ、 p、qはp+q=0~8の整数、炭化水素基は炭素数1~20の脂肪族基、芳香族基からなる群から選ばれる。 Y2は単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキリデン基、シクロアルキレン基、シクロアルキリデン基、ハロ置換アルキリデン

基、フェニルアルキリデン基、カルボニル基、スルホン基、脂肪族ホスフィンオキシド基、芳香族ホスフィンオキシド基、アルキルシラン基、ジアルキルシラン基、フルオレン基からなる群から選ばれる。樹脂組成物中にR4あるいはY2の異なる2価フェノール残基を2種以上含んでもよい。]

[0014]

【発明の実施の形態】本発明者らは、高屈折率で低分散 な熱可塑性樹脂を見出すべく鋭意検討した結果、5価の リン原子を有する構造、中でもホスホン酸構造をポリマ ーの主鎖に導入することによって、無色透明で高屈折、 低分散な熱可塑性樹脂が得られることを見いだした。式

(ここで、nd:d線屈折率(波長587.6nm)、 nf:f線屈折率(波長656.3nm)、nc:c線 屈折率(波長486.1nm))

すなわちその数値が大きいほど低分散であることを示し ている。

【0017】リン系官能基を含有する樹脂は種々知られ ているが、特にホスホン酸エステル基を主鎖に含む樹脂 はポリホスホネートと呼ばれ (K. S. Kim, J. Appl. Po lym.Sci., <u>28</u>, 1119 (1983); Y. Imai et al, Makromo 1. Chem., Rapid Commun., 1, 419 (1980); USP371972 7)、難燃機能などを目指し精力的な研究が行われてい る。これら公知のポリホスホネート系樹脂の光学特性や 力学特性などの諸物性については詳細な知見がなかった ため、本発明者らはそれらを合成し物性評価を行った。 結果として、それら公知のポリホスホネート系樹脂は、 低分子量体ゆえに力学特性が不十分であったり、屈折率 や光分散特性が不十分であった。本発明者らはそれらの 特性を向上すべく鋭意検討した結果、本発明に至った。 また、本発明者らは、本発明樹脂を含有するガット、プ レートあるいはフィルム状成型体は、優れた難燃性をも 具備していることを見出した。

【0018】さらに本発明者らは、本発明樹脂を光学異方体に成型した場合、位相差フィルム(別称として、位相差板、入/4板、あるいは円偏光板)用途において、優れた複屈折/波長分散特性を示すことを見出した。一般的な樹脂の光学異方体、例えば一軸延伸したフィルムに光を透過させた場合、その光の波長が短いほど複屈折率が大きくなり、その度合いは波長の短い領域ほど大きいという傾向がある。位相差フィルム用途においては、複屈折率と波長の関係に関して次の条件を満たすものが光学的に理想であるといえる。すなわち、(1)数百ミクロン以下のフィルムにおいて十分な大きさの複屈折率を有すること、(2)このとき複屈折率の波長による変化が一定、すなわち複屈折率と波長の関係が比例関係(一次の関係)であること、である。

【0019】これらの条件を満たし、複屈折/波長分散 特性の異なる2種の光学異方フィルムを組み合わせるこ (3)はホスホン酸残基の共重合分率を表す式であり、すなわち、(a)は構造式(1)に示すホスホン酸残基のモル数であり、(b)はカーボネート残基のモル数を示す。構造式(1)で示されるホスホン酸残基のモル分率が0.5未満である場合には、ポリマーの高屈折性が発現せず、本発明の効果が得られ難い。さらに、ホスホン酸残基のモル分率が〔(a)/{(a)+(b)}〕≧0.75の範囲にあることが好ましい。

【0015】一方、光学物質の光の分散の度合いを表す 指標としては一般にアッベ数が用いられ、次式(6)に よって算出される。

[0016]

$$アッベ数(\nu d) = (nd-1)/(nf-nc)$$
 (6)

とによって理想的な位相差フィルムを作成することができる。本発明者らは、本発明樹脂を製膜して得られたフィルムを延伸することによって光学異方体とした場合、従来の樹脂に比べ複屈折と波長の関係がより一次の関係に近くなること、またこの本発明の延伸フィルムと従来のポリアルカン系樹脂の光学異方フィルムとを組み合わせることにより、優れた波長分散特性を有する位相差フィルムが得られることを見出した。

【0020】上記構造式(1)または(4)で表される 化合物のリン原子上の置換基R1またはR3の具体例と しては、フェニル、ハロ置換フェニル、メトキシフェニ ル、エトキシフェニル、エチル、イソプロピル、シクロ ヘキシル、ビニル、アリル、ベンジル、アミノアルキ ル、ヒドロキシアルキル、ハロ置換アルキル、アルキル サルファイド基等が挙げられる。このようなホスホン酸 残基を構成するホスホン酸を具体的に例示すると、メチ ルホスホン酸、エチルホスホン酸、n-プロピルホスホ ン酸、イソプロピルホスホン酸、n-ブチルホスホン 酸、イソブチルホスホン酸、セーブチルホスホン酸、n -ペンチルホスホン酸、ネオペンチルホスホン酸、シク ロヘキシルホスホン酸、ベンジルホスホン酸、クロロメ チルホスホン酸、ジクロロメチルホスホン酸、ブロモメ チルホスホン酸、ジブロモメチルホスホン酸、2-クロ ロエチルホスホン酸、1,2-ジクロロエチルホスホン 酸、2-ブロモエチルホスホン酸、1,2-ジプロモエ チルホスホン酸、3-クロロプロピルホスホン酸、2, 3-ジクロロプロピルホスホン酸3-ブロモプロピルホ スホン酸、2, 3-ジブロモプロピルホスホン酸、2-クロロー1-メチルエチルホスホン酸、1,2-ジクロ ロー1-メチルエチルホスホン酸、2-ブロモー1-メ チルエチルホスホン酸、1,2-ジブロモー1-メチル エチルホスホン酸、4-クロロブチルホスホン酸、3, 4-ジクロロブチルホスホン酸、4-ブロモブチルホス ホン酸、3,4-ジブロモブチルホスホン酸、3-クロ ロー1-メチルプロピルホスホン酸、2,3-ジクロロ -1-メチルプロピルホスホン酸、3-ブロモ-1メチ ルプロピルホスホン酸、2,3-ジブロモ-1-メチル

ホスホン酸、1-クロロメチルプロピルホスホン酸、1 -クロロー1-クロロメチルプロピルホスホン酸、1-ブロモメチルプロピルホスホン酸、1-ブロモ-1-ブ ロモメチルプロピルホスホン酸、5-クロロペンチルホ スホン酸、4,5ージクロロペンチルホスホン酸、5-ブロモペンチルホスホン酸、4,5-ジブロモペンチル ホスホン酸、1-ヒドロキシメチルホスホン酸、2-ヒ ドロキシエチルホスホン酸、3-ヒドロキシプロピルホ スホン酸、4-ヒドロキシブチルホスホン酸、5-ヒド ロキシペンチルホスホン酸、1-アミノメチルホスホン 酸、2-アミノエチルホスホン酸、3-アミノプロピル ホスホン酸、4-アミノブチルホスホン酸、5-アミノ ペンチルホスホン酸、メチルチオメチルホスホン酸、メ チルチオエチルホスホン酸、メチルチオプロピルホスホ ン酸、メチルチオブチルホスホン酸、エチルチオメチル ホスホン酸、エチルチオエチルホスホン酸、エチルチオ プロピルホスホン酸、プロピルチオメチルホスホン酸、 プロピルチオエチルホスホン酸、ブチルチオメチルホス ホン酸、フェニルホスホン酸、4-クロロフェニルホス ホン酸、3,4-ジクロロフェニルホスホン酸、3,5 ージクロロフェニルホスホン酸、4ープロモフェニルホ スホン酸、3,4-プロモフェニルホスホン酸、3,5 **-ブロモフェニルホスホン酸、4-メトキシフェニルホ** スホン酸、3,4-ジメトキシフェニルホスホン酸、1 -ナフチルホスホン酸、2-ナフチルホスホン酸、5, 6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチルホスホン酸、 5, 6, 7, 8-テトラヒドロー1-ナフチルホスホン 酸、ベンジルホスホン酸、4-ブロモフェニルメチルホ スホン酸、3,4-ジブロモフェニルメチルホスホン 酸、3,5-ジブロモフェニルメチルホスホン酸、2-フェニルエチルホスホン酸、2-(4-ブロモフェニ ル) エチルホスホン酸、2-(3,4-ジブロモフェニ ル) エチルホスホン酸、2-(3,5-ジブロモフェニ ル) エチルホスホン酸、3-フェニルプロピルホスホン 酸、3-(4-ブロモフェニル)プロピルホスホン酸、 3-(3,4-ジブロモフェニル)プロピルホスホン 酸、3-(3,5-ジブロモフェニル)プロピルホスホ ン酸、4-フェニルブチルホスホン酸、4-(4-ブロ モフェニル) ブチルホスホン酸、4-(3,4-ジブロ モフェニル) ブチルホスホン酸、4-(3,5-ジブロ モフェニル) ブチルホスホン酸、2~ピリジルホスホン 酸、3-ピリジルホスホン酸、4-ピリジルホスホン 酸、1-ピロリジノメチルホスホン酸、1-ピロリジノ エチルホスホン酸、1-ピロリジノプロピルホスホン 酸、1-ピロリジノブチルホスホン酸、ピロール-1-ホスホン酸、ピロールー2ーホスホン酸、ピロールー3 -ホスホン酸、チオフェン-2-ホスホン酸、チオフェ ン-3-ホスホン酸、ジチアン-2-ホスホン酸、トリ チアン-2-ホスホン酸、フラン-2-ホスホン酸、フ ラン-3-ホスホン酸、ビニルホスホン酸、アリルホス

ホン酸などが挙げられ、またこれらのリン原子に2重結合で結合している酸素原子が硫黄原子に置換されたチオホスホン酸も同様に挙げられる。これらは1種類でも、複数種併用することもできる。また、これらホスホン酸はその酸塩化物、エステル、アミドなどのホスホン酸誘導体であってもよい。

【0021】またこれらホスホン酸残基については、それぞれ対応する3価のリン官能基であるホスホナイト残基に一部置き換えてもよい。これにより樹脂の耐酸化性を付与することができるが、光学特性等の特性安定性を考慮すると、その置換比率は50%以下が好ましく、より好ましくは25%以下、さらに好ましくは10%以下である

【0022】また、構造式(2)または(5)で表され る2価フェノール残基を構成する2価フェノールを具体 的に例示すると、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1ービス(4-メチル-2-ヒドロキシフ ェニル) メタン、1, 1ービス(3, 5ージメチルー4 ーヒドロキシフェニル)メタン、2,2ービス(4ーヒ ドロキシフェニル) -4-メチルペンタン、1,1-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1 ービス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘプタン、 1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロオクタ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロデ カン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロ ドデカン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プ ロパン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフ ェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジメチルー 4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、1,1 ービス(4 ーヒドロキシフェニル)-2-エチルヘキサ ン、2,2-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン、1,1-ビス(3-メチル-4-ヒド ロキシフェニル) メタン、4,4'ービフェノール、 2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) ブタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-2-メチルプロ パン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)オクタン、1,1-ビス(3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル) シクロヘキサン、2,2-ビス(3-ア リルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービ ス(3-イソプロピル-4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、2, 2-ビス(3-tert-ブチル-4-ヒド ロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-sec ブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、ビスフェ ノールフローレン、1,1-ビス(2-メチルー4-ヒ ドロキシー5ーtertーブチルフェニル) -2ーメチ ルプロパン、4,4'-[1,4-フェニレンービス (2-プロピリデン)]ービス(2-メチルフェノー

ル)、1,1-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフ ェニル) シクロヘキサン、4,4'ージヒドロキシフェ ニルエーテル、1,1-ビス(2-ヒドロキシフェニ ル) メタン、2、4'-メチレンビスフェノール、1, 1-ビス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)メタ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパ ン、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニ ル) エタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -3-メチルーブタン、1,1-ビス(2-ヒドロキシ -3,5-ジメチルフェニル)メタン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、1,1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)シクロペ ンタン、3、3ービス(4ーヒドロキシフェニル)ペン タン、3,3ービス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェ ニル)ペンタン、3,3ービス(3,5ージメチルー4 ーヒドロキシフェニル)ペンタン、2,2ービス(2-ヒドロキシー3,5ージメチルフェニル)プロパン、 $2, 2 - \forall \lambda (4 - \xi)$ しょうフェニル $\lambda (4 - \xi)$ ファニル $\lambda (4 - \xi)$ ファニ **1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)-1** ーフェニルエタン、1,1ービス(3,5ージメチルー 4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)デカン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)デカン、1,1-ビス(2 -ヒドロキシー3-tert-ブチルー5-メチルフェ ニル) メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) ジフェニルメタン、テルペンジフェノール、1,1 ービス(3-tertーブチル-4-ヒドロキシフェニ ル)シクロヘキサン、1,1-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシー5-tert-ブチルフェニル)-2-メ チルプロパン、2,2-ビス(3-シクロヘキシルー4 ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,1ービス(3, 5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) メ タン、1,1-ビス(3,5-ジsecブチル-4-ヒ ドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(3-シクロ ヘキシルー4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、 $1, 1-\forall \lambda (2-\forall 1)$ ブチルフェニル) エタン、1,1-ビス(3-ノニルー 4-ヒドロキシフェニル)メタン、2,2-ビス(3, 5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プ ロパン、1, 1-ビス(2-ヒドロキシ-3, 5-ジt ertーブチルー6-メチルフェニル)メタン、1,1 ーピス(3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル)-1 ーフェニルエタン、4,4ービス(4ーヒドロキシフェ ニル)ペンタン酸、ビス (4-ヒドロキシフェニル)酢 酸ブチルエステル、1,1-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1-ビス(2-ヒド ロキシー5ーフルオロフェニル) メタン、2,2ービス (4-1)-ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3-フルオ ロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,1ーピス

(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) -1-フェ ニルメタン、1,1-ビス(3-フルオロー4-ヒドロ キシフェニル) -1- (p-フルオロフェニル) メタ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-(p-フルオロフェニル)メタン、2,2-ビス(3-クロロー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル)プロパ ン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシ フェニル)プロパン、2,2-ビス(3-クロロー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1、1-ビス(3,5 ージブロモー4ーヒドロキシフェニル)メタン、2,2 ービス(3,5ージブロモー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2,2ービス(3-ニトロー4-ヒドロキシ フェニル)プロパン、3,3'ージメチルー4,4'ー ピフェノール、3,3',5,5'ーテトラメチルー 4, 4'ーピフェノール、3, 3', 5, 5'ーテトラ tert-ブチル-4, 4'-ビフェノール、ビス(4 ーヒドロキシフェニル)ケトン、3,3'ージフルオロ -4, 4' - $\forall 7$ = 1 ラフルオロー4, 4'ービフェノール、ビス(4-ヒド ロキシフェニル) ジメチルシラン、ビス (4-ヒドロキ シフェニル) スルホン、ビス (3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル) スルホン、ビス(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル)スルホン、ピス(3,5ージブ ロモー4ーヒドロキシフェニル) スルホン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) チオエーテル、ビス (3-メチル -4-ヒドロキシフェニル) エーテル、ピス (3-メチ ルー4ーヒドロキシフェニル) チオエーテル、ビス (3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)エーテ ル、ビス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニ ル)チオエーテル、1,1-ビス(2,3,5-トリメ チルー4ーヒドロキシフェニル) -1-フェニルメタ ン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ドデカ ン、2,2ービス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニ ル)ドデカン、2,2-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)ドデカン、1,1-ビス(3-t ertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)ー1ーフェ ニルエタン、1, 1-ビス(3, 5-ジtert-ブチ ルー4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、 1,1-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シク ロヘキシルフェニル) -2-メチルプロパン、1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジtert-ブチルフ ェニル) エタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン酸メチルエステル、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシフェニル) プロパン酸エチルエステル、イサチ ンビスフェノール、イサチンビスクレゾール、2, 2', 3, 3', 5, 5'-ヘキサメチル-4, 4'-ピフェノール、ビス (2-ヒドロキシフェニル)メタ ン、2,4'ーメチレンビスフェノール、1,2ービス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、2-(4-ヒドロ キシフェニル) -2-(2-ヒドロキシフェニル)プロ

パン、ビス(2-ヒドロキシ-3-アリルフェニル)メ タン、1,1-ビス(2-ヒドロキシー3,5-ジメチ ルフェニル)-2-メチルプロパン、1,1-ビス(2 ーヒドロキシー5-tert-ブチルフェニル) エタ ン、ピス(2-ヒドロキシ-5-フェニルフェニル)メ タン、1,1-ピス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5 -tert-ブチルフェニル) ブタン、ビス (2-メチ ルー4-ヒドロキシー5-シクロヘキシルフェニル) メ タン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタ デカン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフ ェニル)ペンタデカン、2,2-ビス(3,5-ジメチ ルー4ーヒドロキシフェニル)ペンタデカン、1,2-ビス(3,5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフ ェニル) エタン、ビス (2-ヒドロキシ-3, 5-ジt ertーブチルフェニル)メタン、2,2-ビス(3-スチリル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1 ービス(4-ヒドロキシフェニル)-1-(p-ニトロ フェニル) エタン、ビス(3,5-ジフルオロー4-ヒ ドロキシフェニル)メタン、ビス(3,5-ジフルオロ -4-L † D $^$ ス(3,5-ジフルオロー4-ヒドロキシフェニル)ジ フェニルメタン、ビス (3-フルオロ-4-ヒドロキシ フェニル) ジフェニルメタン、2,2-ビス(3-クロ ロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、3,3', 5, 5'-テトラtert-ブチル-2, 2'-ビフェ ノール、2, 2'ージアリルー4, 4'ーピフェノー ル、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5ートリメチルーシクロヘキサン、1,1ービス メチルーシクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキ シフェニル)-3,3,4-トリメチルーシクロヘキサ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3 ージメチルー5ーエチルーシクロヘキサン、1,1ービ ス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチ ルーシクロペンタン、1,1-ビス(3,5-ジメチル -4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチル ーシクロヘキサン、1,1ービス(3,5ージフェニル -4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチル ーシクロヘキサン、1,1ービス(3-メチルー4-ヒ ドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチルーシクロ ヘキサン、1,1-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキ シフェニル) -3, 3, 5-トリメチルーシクロヘキサ ン、1,1-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシ フェニル) -3, 3, 5-トリメチルーシクロヘキサ ン、9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレ ン、9,9-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル)フルオレン、1,1-ビス(3,5-ジブロ モー4-ヒドロキシフェニル)-3,3,5-トリメチ ν ーシクロヘキサン、 α 、 α ービス(4ーヒドロキシフ ェニル)-1,4-ジイソプロピルベンゼン等が挙げら

れ、これらは1種類でも、複数種併用することもできる。これら2価フェノールは得られるポリマーの性能に 応じて用いることができる。

【0023】また、ジヒドロキシベンゼンを本発明の効 果が損なわれない範囲で用いることができ、これらジヒ ドロキシベンゼンとしては、レゾルシノール、ハイドロ キノン、1,2-ジヒドロキシベンゼン等が挙げられ、 これらは1種類でも、複数種併用することもできる。 【0024】また、本発明のポリマーは必ずしも直鎖状 である必要はなく、得られるポリマーの性能に応じて多 価フェノールを共重合することができる。このような多 価フェノールを具体的に例示すると、トリス(4-ヒド ロキシフェニル) メタン、4、4'-[1-[4-[1 - (4-ヒドロキシフェニル) - 1-メチルエチル)フ ェニル〕エチリデン〕ビスフェノール、2,3,4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、4-〔ビス (4-ヒドロキシフェニル)メチル]-2-メトキシフ ェノール、トリス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、4-〔ビス(3-メチル-4-ヒドロキシ フェニル)メチル]-2-メトキシフェノール、4-〔ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) メチル〕 - 2 - メトキシフェノール、1, 1, 1 - トリ ス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1,1-ト リス (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) エタン、 1, 1, 1-トリス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル) エタン、トリス(3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル) メタン、トリス(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル)メタン、2,6-ビス〔(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)メチル]-4-メチ ルフェノール、4-〔ビス(3,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル) メチル]-1, 2-ジヒドロキシベ ンゼン、2-〔ビス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5 ーシクロヘキシルフェニル) メチル] ーフェノール、4 -〔ビス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シクロへ キシルフェニル) メチル〕-1,2-ジヒドロキシベン ゼン、4-メチルフェニル-1,2,3-トリヒドロキ シベンゼン、4-〔(4-ヒドロキシフェニル)メチ ル〕-1,2,3-トリヒドロキシベンゼン、4-〔1 - (4-ヒドロキシフェニル) - 1-メチルーエチル〕 -1, 3-ジヒドロキシベンゼン、4-〔(3,5-ジ メチルー4ーヒドロキシフェニル)メチル〕-1,2, 3-トリヒドロキシベンゼン、1,4-ビス〔1-ビス (3, 4-ジヒドロキシフェニル) -1-メチルーエチ ル] ベンゼン、1,4-ビス[1-ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル) -1-メチル-エチル] ベン ゼン、2,4ービス〔(4-ヒドロキシフェニル)メチ ル]-1,3-ジヒドロキシベンゼン、2-〔ビス(3 -メチル-4-ヒドロキシフェイル)メチル〕フェノー ル、4-〔ピス(3-メチル-4-ヒドロキシフェイ ル)メチル)フェノール、2-[ビス(2-メチル-4

ーヒドロキシフェイル) メチル] フェノール、4ー〔ビ ス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル)-1,2-ジヒドロキシベンゼン、4-〔ビス(4-ヒド ロキシフェニル) メチル] -2-エトキシフェノール、 2-〔ビス(2,3-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル)メチル)フェノール、4-〔ビス(3,5-ジメチ ルー4ーヒドロキシフェニル)メチル]フェノール、3 -〔ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル)メチル〕フェノール、2-〔ビス(2-ヒドロキシ -3,6-ジメチルフェニル)メチル〕フェノール、4 -〔ビス(2-ヒドロキシ-3,6-ジメチルフェニ ル)メチル)フェノール、4-(ビス(3,5-ジメチ ルー4-ヒドロキシフェニル) メチル〕-2-メトキシ フェノール、3,6-〔ビス(3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)メチル]-1,2-ジヒドロキシ ベンゼン、4,6-〔ビス(3,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル)メチル]-1,2,3-トリヒドロ キシベンゼン、2-〔ビス(2,3,6-トリメチルー 4-ヒドロキシフェニル) メチル〕 フェノール、2-〔ビス(2、3、5ートリメチルー4ーヒドロキシフェ ニル)メチル〕フェノール、3-〔ビス(2,3,5-トリメチルー4ーヒドロキシフェニル) メチル] フェノ ール、4-〔ビス(2、3、5-トリメチルー4-ヒド ロキシフェニル) メチル) フェノール、4-〔ビス (2, 3, 5-トリメチルー4-ヒドロキシフェニル) メチル〕-1,2-ジヒドロキシベンゼン、3-〔ビス (2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシルフ ェニル) メチル〕 フェノール、4 – 〔ビス(2 – メチル -4-ヒドロキシー5-シクロヘキシルフェニル)メチ ル〕フェノール、4-〔ピス(2-メチル-4-ヒドロ キシー5-シクロヘキシルフェニル)メチル]-2-メ トキシフェノール、2,4,6-[トリス(4-ヒドロ キシフェニルメチル)-1,3-ジヒドロキシベンゼ ン、1,1,2,2-テトラ(3-メチルー4-ヒドロ キシフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラ(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 4-(「ビス(4-ヒドロキシフェニル)メチル))べ ンゼン、1,4-ジ〔ピス(3-メチル-4-ヒドロキ シフェニル)メチル)ベンゼン、1,4-ジ[ビス (3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチ ル〕ベンゼン、4-〔1,1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) エチル] アニリン、(2,4-ジヒドロキシフ ェニル) (4-ヒドロキシフェニル) ケトン、2-〔ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)メチル]フェノール、 1,3,3-トリ(4-ヒドロキシフェニル)ブタン等 が挙げられ、これらは1種類でも、複数種併用すること もできる。

【0025】本発明のポリマーの一般的な製造方法としては、酸ハライドと2価のフェノールを有機溶剤中で反応させる溶液重合法(A. Conix, Ind. Eng. Chem., 51,

147(1959)、特公昭37-5599号公報)、酸ハライ ドと2価のフェノールを塩化マグネシウム等の触媒存在 下で加熱する溶融重合法、2価の酸と2価のフェノール をジアリルカーボネートの存在下で加熱する溶融重合法 (特公昭38-26299号公報)、水と相溶しない有 機溶剤に溶解せしめた2価の酸ハライドとアルカリ水溶 液に溶解せしめた2価のフェノールとを混合する界面重 合法(W. M.Eareckson, J. Poly. Sci., XL 399 (195 9)、特公昭40-1959号公報)等が挙げられるが、 特に溶液重合法が好適に採用される。溶液重合法につい て一例を説明すると、ホスホン酸残基の前駆体分子であ るホスホン酸誘導体と、2価フェノールをトリエチルア ミンなどの塩基存在下混合して反応させ、続いてカーボ ネート残基の前駆体分子、たとえばトリホスゲンなどを 添加して縮合重合することによって本発明の樹脂を得る ことができる。このとき、ホスホン酸誘導体とトリホス ゲンを同時に添加し反応させるのではなく、トリホスゲ ンをホスホン酸誘導体添加後に添加することによって、 より高分子量体を得ることができる。ホスホン酸誘導体 あるいはカーボネート誘導体としてはそれらのハロゲン 化物、酸無水物、エステル等が用いられるが特に限定さ れない。

【0026】本発明のポリマーの分子量を調節する方法としては、重合時に一官能の物質を添加して行うことができる。ここで言う分子量調節剤として用いられる一官能物質としては、フェノール、クレゾール、pーtertーブチルフェノール等の一価フェノール類、安息香酸クロライド、メタンスルホニルクロライド、フェニルクロロホルメート等の一価酸クロライド類が挙げられる。【0027】本発明のポリマーには、その特性を損なわない範囲で、ヒンダードフェノール系、ヒンダードアミン系、チオエーテル系、燐系の各種抗酸化剤を添加することができる。

【0028】また、本発明のポリマーは、有機溶媒に対して高い溶解性を有しており、このような溶媒としては、塩化メチレン、クロロホルム、1,1,2,2ーテトラクロロエタン、1,2ージクロロエタン、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、トルエン、キシレン、アーブチロラクトン、ベンジルアルコール、イソホロン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロパノール等が挙げられる。さらに、本発明のポリマーは非晶性であるが、非晶性であるかどうかは公知の方法、例えば示差走差熱量分析(DSC)や動的粘弾性測定等により融点が存在しているかどうかを確認すればよい。

[0029]

【実施例】本発明の具体的実施態様を以下に実施例をもって述べるが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0030】実施例1

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100ml) 中にメチルベンジリデンビスフェノール (40mmo およびトリエチルアミン(88mmo1)を混合 し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルホスホン酸ジ クロライド(30mmol)の1,2-ジクロロエタン (45m1)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後 室温で120分間攪拌した。その後、濃度0.571m o1/1であるトリホスゲンの1,2-ジクロロエタン (5.83m1)溶液を30分かけて滴下し、滴下終了 後120分間攪拌した。次にオイルバスを用いて溶液温 度70℃で120分間攪拌した。その後、12時間室温 にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000m1に 投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノ ール2000m1、(2) 水/エタノール=1/1混合 溶液2000m1、(3)水2000m1の順で生成し たポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率89 %で得た。

【0031】得られた樹脂粉末は下記に示す方法で成型し評価した。すなわちプレス成形の場合は、得られた樹脂粉末を、樹脂のガラス転移温度点以上である250℃に加熱した金型に投入した。金型はφ30mmの円盤状のプレートが成形可能なもの用いた。金型を閉じ、圧力2tにて加圧後、金型を冷却した。金型を分割することによってφ30mm、厚さ3mmの円盤状の樹脂プレートを得た。さらに溶融粘度の低い場合には試験管に封入して溶融成形することもできる。すなわち、得られた樹脂粉末を、外形24mmの試験管に3g投入し試験管内を真空にして、真空下にて樹脂をヒーターにて試験管でと280℃に加熱した。樹脂の溶融を確認した後、ヒーターを止め試験管を冷却した。試験管冷却後、樹脂の固化を確認して試験管のみを破壊して樹脂の塊を得た。

【0032】得られた樹脂成形サンプルをサンドペーパー、バフ研磨した。互いに直行する2面を研磨し、それらが鏡面仕上げになるように研磨した。

【0033】研磨した樹脂サンプルを屈折計(カルニュー光学工業(株)製: KPR-2)にて評価を行い、d線(波長:587.6nm)屈折率(nd)、式(4)より求められるアッベ数(νd)を測定した。

【0034】さらに、得られた樹脂の力学特性について、幅10mm、長さ25mm、厚さ3mmの板状に成型し、オリエンテック(株)社製テンシロン(型式RTM-100)を用い、支点間距離22mm、曲げ速度1.5mm/分にて曲げ試験を行った。評価パラメーターは脆さの指標である靭性値(曲げ応力×破断変位)とした。

【0035】実施例2

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100m1) 中にメチルベンジリデンビスフェノール(40mmo 1)、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3,5 -ジ-t-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロビオ ネート] (0.15g)、およびトリエチルアミン(88mmol)を混合し、氷冷下撹拌した。この溶液にフェニルチオホスホン酸ジクロライド(30mmol)の1,2-ジクロロエタン(45ml)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間撹拌した。その後、濃度0.571mol/1であるトリホスゲンの1,2-ジクロロエタン(5.83ml)溶液を30分かけて滴下し、滴下終了後120分間撹拌した。

【0036】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000mlに投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000ml、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000ml、(3)水2000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率90%で得た。その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。

【0037】実施例3

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100ml)中に1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへキサン(40mmol)、およびトリエチルアミン(88mmol)を混合し、氷冷下撹拌した。この溶液にフェニルホスホン酸ジクロライド(30mmol)の1,2-ジクロロエタン(45ml)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間撹拌した。その後、濃度0.571mol/lであるトリホスゲンの1,2-ジクロロエタン(5.83ml)溶液を30分かけて滴下し、滴下終了後120分間撹拌した。

【0038】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で120分間撹拌した。その後、12時間室温にて撹拌を行った。反応溶液をヘキサン2000mlに投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000ml、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000ml、(3)水2000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率91%で得た。その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。

【0039】実施例4

窒素雰囲気下、1, 2-ジクロロエタン(100m1)中に1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへキサン(40mmo1)、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3, 5-ジーセーブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート](0. 15g)、およびトリエチルアミン(88mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルチオホスホン酸ジクロライド(30mmo1)の1, 2-ジクロロエタン(45m1)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間攪拌した。その後、濃度1200、1200、1200 1

【0040】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で

120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000mlに投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000ml、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000ml、(3)水2000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率92%で得た。その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。【0041】実施例5

窒素雰囲気下、1, 2-ジクロロエタン(100m1)中に1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへキサン(32mmo1)、 α 、 $\alpha-$ ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 4-ジイソプロピルベンゼン(8mmo1)、およびトリエチルアミン(88mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルホスホン酸ジクロライド(32mmo1)の1, 2-ジクロロエタン(45m1)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間攪拌した。その後、濃度0.571mo1/1であるトリホスゲンの1, 2-ジクロロエタン(4.66m1)溶液を30分かけて滴下し、滴下終了後120分間攪拌した。

【0042】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000m1に投入して再沈し、ポリマーをデ取した後、(1)エタノール2000m1、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000m1、(3)水2000m1の順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率88%で得た。その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。【0043】実施例6

窒素雰囲気下、1, 2-ジクロロエタン(100m1)中に1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへキサン(36mmo1)、 α 、 $\alpha-$ ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 4-ジイソプロピルベンゼン(4mmo1)、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3, 5-ジーセーブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート](0. 15g)、およびトリエチルアミン(88mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルチオホスホン酸ジクロライド(30mmo1)の1, 2-ジクロロエタン(45m1)溶液を60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間攪拌した。その後、濃度0. 571mo1/1であるトリホスゲンの1, 2-ジクロロエタン(5. 83m1)溶液を30分かけて滴下し、滴下終了後120分間攪拌した。

【0044】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000m1に投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000m1、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000m1、(3)水2000m1の順で生成したポリマー

を洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率90%で得た。 その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。 【0045】実施例7

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100m1) 中に1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへ キサン(40mmo1)、およびトリエチルアミン(8 8mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液に濃 度0.571mo1/1であるトリホスゲンの1,2-ジクロロエタン(1.75ml)溶液を滴下した。その 後フェニルチオホスホン酸ジクロライド (29.6mm o1)の1,2-ジクロロエタン(45ml)溶液を、 続いてベンゼンホスホナスジクロライド(0.4mmo 1)の 1,2-ジクロロエタン(15ml)溶液を滴 下し、滴下終了後室温で120分間攪拌した。その後、 濃度0.571mo1/1であるトリホスゲンの1,2 ージクロロエタン (4.08ml)溶液を30分かけて **滴下し、その後、12時間室温にて攪拌を行った。その** 後、反応溶液をヘキサン2000mlに投入して再沈 し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000 m1、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000 m1、(3)水2000m1の順で生成したポリマーを 洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率94%で得た。そ の後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。

【0046】実施例8

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100m1) 中に1.1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへ キサン (36mmο1)、α、α – ビス (4 – ヒドロキ シフェニル)-1,4-ジイソプロピルベンゼン(4m mo1) 、ペンタエリスリチルーテトラキス[3- $(3, 5-\tilde{y}-t-\tilde{y}+\tilde{y}-4-t)$ プロピオネート](0.15g)、およびトリエチルア ミン(88mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。この 溶液にフェニルチオホスホン酸ジクロライド (27mm o1)とベンゼンホスホナスジクロライド(3mmo 1)の1,2-ジクロロエタン(45ml)混合溶液を 60分間かけて滴下し、滴下終了後室温で120分間攪 拌した。その後、濃度0.571mo1/1であるトリ ホスゲンの1,2-ジクロロエタン(5.83m1)溶 液を30分かけて滴下し、滴下終了後120分間攪拌し た。

【0047】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を行った。反応溶液をヘキサン2000mlに投入して再沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール2000ml、(2)水/エタノール=1/1混合溶液2000ml、(3)水2000mlの順で生成したポリマーを洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率94%で得た。その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。【0048】実施例9

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(100ml)

中に1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロド デカン(40mmo1)、およびトリエチルアミン(8 8mm o 1)を混合し、氷冷下攪拌した。この溶液にフ ェニルホスホン酸ジクロライド(30mmol)の1, 2-ジクロロエタン(45m1)溶液を60分間かけて 滴下し、滴下終了後室温で120分間攪拌した。その 後、濃度O. 571mol/1であるトリホスゲンの 1,2-ジクロロエタン(5.83ml)溶液を30分 かけて滴下し、滴下終了後120分間攪拌した。

【0049】次にオイルバスを用いて溶液温度70℃で 120分間攪拌した。その後、12時間室温にて攪拌を 行った。反応溶液をヘキサン2000m1に投入して再 沈し、ポリマーを沪取した後、(1)エタノール200 0m1、(2)水/エタノール=1/1混合溶液200 0m1、(3)水2000m1の順で生成したポリマー を洗浄、乾燥して目的の樹脂粉末を収率88%で得た。 その後、実施例1と同様の方法で成型して評価した。

【0050】実施例10

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(50ml)中 にメチルベンジリデンビスフェノール (20mmo 1)、およびトリエチルアミン(40mmo1)を混合 し、氷冷下攪拌した。この溶液にフェニルチオホスホン 酸ジクロライド(20mmo1)の1, 2-ジクロロエ タン(60m1)溶液を35分間かけて滴下し、滴下終 了後室温で90分間攪拌した。その後、実施例1と同様 に処理(収率95%)し、つづいて同様の方法で成形し て評価した。

実施例11

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(50m1)中 にビスフェノールA(20mmol)、およびトリエチ ルアミン(40mmol)を混合し、氷冷下攪拌した。 この溶液にフェニルチオホスホン酸ジクロライド(20 mmo1)の1,2-ジクロロエタン(60m1)溶液 を35分間かけて滴下し、滴下終了後室温で90分間攪 拌した。その後、実施例1と同様に処理(収率92%) し、つづいて同様の方法で成形して評価した。

【0051】実施例12

実施例10で得られた樹脂と市販されているポリカーボ ネート: "タフロンA2200" (出光石油化学(株) 製)を繰り返し単位モル比1対1で溶液混合(濃度0. 5mo1/1の1, 2-ジクロロエタン溶液) し、その 後実施例1と同様に処理し、つづいて同様の方法で成型 して評価した。

【0052】実施例13

実施例11で得られた樹脂と市販されているポリカーボ ネート: "タフロンA2200" (出光石油化学(株) 製)を繰り返し単位モル比1対1で溶液混合(濃度0. 5mol/1の1, 2-ジクロロエタン溶液) し、その 後実施例1と同様に処理し、つづいて同様の方法で成型 して評価した。

【0053】実施例14

実施例7で得られた樹脂を住友ネスタール射出成形機プ ロマット40/25(住友重機械工業(株)製)に供 し、シリンダー温度を250℃の温度に、金型温度を1 00℃に設定し、1/8インチ燃焼試験片を射出成形し て、UL94規格に従って垂直型燃焼テストを行ったと ころ、全く着火せずV-0に相当することがわかった。 【0054】実施例15

実施例7で得られた樹脂(10重量部)と、別途重合し たABS (アクリロニトリル: スチレン=7:3、ゴム 含有率10%) 樹脂(100重量部) をL/D=45の 30mmφ2軸押出機を用いて250℃で溶融混練して ペレットとした。熱風乾燥後、このペレットを住友ネス タール射出成形機プロマット40/25(住友重機械工 業(株)製)に供し、シリンダー温度を250℃の温度 に、金型温度を70℃に設定し、1/8インチ燃焼試験 片を射出成形して、UL94規格に従って垂直型燃焼テ ストを行ったところ、V-2レベルの難燃性であった。 【0055】実施例16

実施例7記載の樹脂を5kg合成し、溶液キャスティン グ法(1,2-ジクロロエタン溶液)によって幅200 mm、厚さ200μmのフィルムを作成した。該フィル ムを延伸温度135℃、延伸速度180mm/minに て1.2倍に延伸した。

【0056】上記条件によって得られたフィルムは、波 長550nmにおけるリタデーションを1とした場合、 波長450nmのリタデーション比は1.100、波長 650 n m の それは 0.942 を 示した。

【0057】比較例1

市販されているポリカーボネート: "タフロンA220 0"(出光石油化学(株)製)を用いて、実施例1と同 様の方法で成型して評価した。

比較例2

市販されているポリメチルメタクリレート: "メタクリ ル酸メチル(ポリマー)"(東京化成工業(株)製)を 用いて、実施例1と同様の方法で成型して評価した。

【0058】比較例3

市販されているポリエーテルスルホンを用いて、実施例 1と同様の方法で成型して評価した。

【0059】比較例4

窒素雰囲気下、1,2-ジクロロエタン(50m1)中 にビスフェノールA(20mmo1)、およびトリエチ ルアミン(40mmo1)を混合し、氷冷下攪拌した。 この溶液にフェニルホスホン酸ジクロライド(20mm o1)の1,2-ジクロロエタン(60m1)溶液を3 5分間かけて滴下し、滴下終了後室温で90分間攪拌し た。その後、実施例1と同様に処理(収率85%)し、 つづいて同様の方法で成形して評価した。

【0060】比較例5

比較例4で得られた樹脂と市販されているポリカーボネ

ート: "タフロンA2200" (出光石油化学(株) 製)を繰り返し単位モル比1対1で溶液混合(濃度0. 5mol/lの1, 2-ジクロロエタン溶液)し、その 後実施例1と同様に処理し、つづいて同様の方法で成型 して評価した。

【0061】比較例6

市販されているポリカーボネート: "タフロンA220 0"(出光石油化学(株)製)を溶液キャスティング法 (1, 2-ジクロロエタン溶液)によって幅200m m、厚さ200μmのフィルムを作成した。該フィルム を延伸温度135℃、延伸速度180mm/minにて 1. 2倍に延伸した。上記条件によって得られたフィル ムは、波長550 nmにおけるリタデーションを1とし た場合、波長450nmのリタデーション比は1.09 2、波長650nmのそれは0.966を示した。

【0062】実施例1~13と比較例1~5の方法で作 成した樹脂の評価結果を表1に示す。

[0063]

【表1】

	屈折率	アッペ数	朝性值
実施例 1	1.619	28.0	30
実施例2	1.639	26.8	28
実施例3	1. 605	30.8	23
実施例4	1.625	29. 1	26
実施例 5	1.610	30. 3	20
実施例 6	1.623	28. 9	19
実施例7	1. 622	29. 2	27
実施例8	1. 623	28. 5	21
実施例 9	1. 580	33. 1	24
実施例10	1.646	26. 1	2
実施例11	1. 633	27. 5	3
実施例12	1.615	28.3	19
実施例13	1.608	29.0	17
比較例1	1. 583	30. 5	30
比較例2	1. 492	56.0	20
比較例3	1. 634	23. 3	31
比較例 4	1.605	29. 6	1
比較例 5	1. 594	30.0	15

【0064】比較例から従来の代表的熱可塑性樹脂は高 屈折なものは高分散、低分散なものは低屈折となり、レ ンズなど光学用途に用いるにはとうてい不十分である。 また実施例10、11の樹脂は脆いものであるが、既存 のポリカーボネートと複合することにそれを補っても高 屈折率・高アッベ数を示した(光学特性は複合した樹脂 のそれを平均した値になることがわかる)。一方、比較 例4はある程度良好な光学特性を示すものの、力学特性 が不十分(極めて脆い)であり、ポリカーボネートと複 合すると力学特性は向上するが、屈折率が1.6以下と なってしまうことがわかる。対して本発明の樹脂は高屈 折、低分散という有用な光学特性と力学特性をともに有 していることがわかる。また実施例14,15からは本 発明の樹脂が優れた難燃性を示すことがわかる。

【0065】さらに実施例16と比較例6からは本発明 の樹脂の光学異方体がポリカーボネートに比べ波長とリ タデーションの関係がより直線的な波長分散特性を有し ていることから、従来のポリカーボネートよりも優れた 位相差フィルム用素材であることがわかる。

[0066]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物は、高屈折率、低分 散な特性を有し、併せて優れた難燃性を有する。汎用的 な成形体あるいはフィルムの用途など各種分野に用いる ことができるほか、特にレンズあるいは光学用のフィル ムなどにおいて用いることにより優れた効果をより一層 発揮するものである。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

CO8L 85:02

テーマコード(参考)

// CO8L 85:02

Fターム(参考) 2H049 BA06 BA42 BB42 BC03 BC22 4F071 AA47 AA50 AA68 AA75 AF23 AF31 BB01 BB13 BC01 BC03 RC07

4J030 CB33 CB35 CG06 CG19

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

BLACK BURDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
Lines or marks on original document
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.